

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 2 部門第 1 区分

【発行日】令和 3 年 11 月 18 日 (2021.11.18)

【公表番号】特表 2020-536736 (P2020-536736A)

【公表日】令和 2 年 12 月 17 日 (2020.12.17)

【年通号数】公開・登録公報 2020-051

【出願番号】特願 2020-540846 (P2020-540846)

【国際特許分類】

B 0 1 J 19/10 (2006.01)

B 0 1 F 11/00 (2006.01)

C 0 8 J 3/20 (2006.01)

【F I】

B 0 1 J 19/10

B 0 1 F 11/00 Z

C 0 8 J 3/20 C E R Z

C 0 8 J 3/20 C E Z

【手続補正書】

【提出日】令和 3 年 10 月 8 日 (2021.10.8)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

材料入口、および、処理材料出口を備えた処理容器を含む連続処理システムであって、材料は、前記容器を通して流れ、前記容器は、材料が通過する一連のゾーンに前記処理容器を分割する一連のディバイダを含み、作動中、前記ゾーンは、材料が前記ディバイダを流れて通過する速度を制御することによって互いから遮蔽されており、増大する真空レベルが、連続ゾーンに印加され、前記システムは、前記ディバイダと材料の接触によって処理材料にエネルギーを与える音響エネルギーを備える、システム。

【請求項 2】

処理材料は、前記処理容器の頂部に導入され、重量下で前記処理装置を下方に前記ゾーンを通して通過し、前記処理材料出口を通して前記容器の底部に向かって離脱される、請求項 1 に記載のシステム。

【請求項 3】

前記ディバイダは、前記処理材料を通過させるための穴を備える、請求項 1 または 2 に記載のシステム。

【請求項 4】

前記処理容器を下る処理材料の流れは、処理材料が、前記ディバイダに設けられた穴を通して流れると同時に、十分な処理材料が、前記処理容器の前記ゾーンの間に遮蔽があることを確保するように処理材料が前記穴を通して流れるときに、ディバイダの設けられた前記穴にあるように、前記ディバイダによって制御される、請求項 3 に記載のシステム。

【請求項 5】

前記処理容器に 3 つのゾーン、すなわち、第 1 のゾーン、第 2 のゾーン、および、第 3 のゾーンを含み、第 1 のゾーンは、処理材料が導入され、大気圧にあるゾーンであり、第 2 のゾーンは、第 1 のディバイダを越えた位置にあり、ゾーンの圧力が、大気圧の 50 % 以下であるような印加された真空を有し、第 3 のゾーンは、第 2 のディバイダを越えた位

置にあり、第 2 のゾーンに印加された真空よりも大きな印加された真空を有し、第 2 のゾーンの圧力は、大気圧の 25 % 以下であり、材料は、増大された真空下で容器から離脱される、請求項 1 ~ 4 のいずれか 1 項に記載のシステム。

【請求項 6】

材料を処理するための方法であって、材料が、ディバイダによって一連のゾーンに分割されている処理容器に送られ、通過され、ゾーンは、処理中に互いから遮蔽され、徐々に増大する真空が、前記処理容器の連続ゾーンに印加され、音響エネルギーが、前記処理容器に印加され、前記ディバイダは、材料を通過させるための穴を備え、前記穴は、遮蔽を提供するために処理中に処理材料で覆われる、方法

【請求項 7】

前記処理容器は、鉛直であり、処理材料は、重力および真空下で前記容器を通して流れる、請求項 6 に記載の方法。